# 06; 09

# Особенности наноструктурирования поверхности кремния в результате ее сверхбыстрого нагрева фемтосекундным лазерным импульсом в воде

### © С.А. Ромашевский

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия E-mail: sa.romashevskiy@gmail.com

#### Поступило в Редакцию 28 февраля 2018 г.

Методом атомно-силовой микроскопии исследована морфология поверхности кремния после воздействия фемтосекундного лазерного импульса в области припороговых плотностей энергий в воде. По мере увеличения плотности энергии поверхность кремния трансформируется в наномасштабную кольцевую и блистерную структуры, а также гладкие и наноструктурированные микрократеры с минимальной глубиной 1 nm. Обнаружено формирование "отпечатков" звездообразной формы на поверхности микрократера при плотностях энергии выше порога абляции.

#### DOI: 10.21883/PJTF.2018.14.46345.17271

Прецизионное модифицирование поверхностных слоев различных твердотельных материалов особенно актуально для солнечной энергетики и электронной промышленности [1,2]. Последние достижения в области селективной модификации объемных и тонкопленочных материалов с помощью фемтосекундных лазерных импульсов (ФЛИ) свидетельствуют об эффективном создании локальных морфологических и структурных модификаций, в том числе удалении нанослоев [3,4] и наноструктурировании поверхности [5], аморфизации и рекристаллизации облученных областей [6,7]. В отличие от многократного воздействия ФЛИ режим однократного воздействия ФЛИ на поверхность монокристаллического кремния [8,9] является сравнительно малоисследованным и сопряжен с нерешенными вопросами физики, в частности термогидродинамического движения расплава на микро- и наномасштабах, а также

58

характерного разлета вещества при припороговых плотностях энергии в жидкости [10]. В настоящей работе сообщается об особенностях морфологии поверхности кремния при ее взаимодействии с водой после однократного сверхбыстрого нагрева ФЛИ.

Излучение иттербиевого фемтосекундного лазера с длительностью импульса  $\tau_p = 350$  fs и длиной волны излучения  $\lambda = 1028$  nm с помощью микрообъектива ( $20 \times$ , NA = 0.5) фокусировалось по нормали на поверхность кремния в пятно диаметром  $d_0 = 8 \,\mu$ m (по уровню 1/e). Образец полированной пластины монокристаллического кремния *n*-типа (толщина 460  $\mu$ m, кристаллографическая ориентация [111]) размещался в чашке Петри [10], заполненной дистиллированной водой. В режиме растрового сканирования поверхности лазерным излучением в диапазоне плотностей энергий  $F_0 = 0.3 - 1.9 \,\text{J/cm}^2$  ( $F_0$  — плотность энергии в центре гауссова пятна) с минимальным шагом  $\Delta F_0 = 0.02 \,\text{J/cm}^2$  было получено не менее десяти поверхностных модификаций при каждой плотности энергии. Исследование морфологии поверхности проводилось методом атомно-силовой микроскопии (ACM) в контактном режиме с разрешением по *z*-оси 0.5 Å.

На рис. 1 представлены АСМ-изображения и поперечные сечения основных поверхностных модификаций кремния, однократно облученного ФЛИ в воде при припороговых плотностях энергии  $F_0 = 0.35 - 0.6 \text{ J/cm}^2$ . По мере увеличения плотности энергии выше порога плавления ( $F_{melt} = 0.3 \text{ J/cm}^2$ ) полированная (среднее арифметическое отклонение профиля  $R_a = 0.1 \text{ nm}$ ) поверхность трансформируется в наномасштабную кольцевую (0.35 J/cm<sup>2</sup>) и блистерную структуры (0.39 J/cm<sup>2</sup>), а также гладкие (0.44 J/cm<sup>2</sup>) и наноструктурированные микрократеры (0.6 J/cm<sup>2</sup>).

При минимальных потоках энергии ( $F_0 = 0.35 \text{ J/cm}^2$ ) на поверхности кремния образуется кольцевая структура высотой 1 nm и шириной  $\sim 120 \text{ nm}$  (FWHM), что объясняется локальным разрушением исходного оксидного слоя вследствие различной температуры плавления кристаллического кремния (1690 K) и его диоксида (1973 K), а также различной плотности кремния в кристаллическом ( $\rho_{c-\text{Si}} = 2.328 \text{ g/cm}^3$ ) и жидком ( $\rho_{l-\text{Si}} = 2.521 \text{ g/cm}^3$ ) состояниях [11,12].

В диапазоне  $F_0 = 0.33 - 0.35 \text{ J/cm}^2$  диаметр кольцевой структуры увеличивается от 1.2 до 2  $\mu$ m (при сохранении высоты и ширины кольца). Однако при  $F_0 = 0.39 \text{ J/cm}^2$  в центре пятна наблюдается формирование блистерной структуры высотой  $\sim 2 \text{ nm}$  с характерным



**Рис. 1.** Особенности наноструктурирования поверхности кремния в результате ее сверхбыстрого нагрева ФЛИ в диапазоне плотностей энергий  $F_0 = 0.35 - 0.6 \text{ J/cm}^2$  в воде. *1* — внешний, *2* — средний, *3* — внутренний бортик.

внутренним кольцом толщиной ~ 360 nm (FWHM). Поскольку в результате однократного воздействия ФЛИ при  $F_{melt} < F_0 < F_{abl}$  ( $F_{abl}$  — порог абляции кремния по плотности энергии) приповерхностный слой толщиной ~ 60 nm в результате сверхбыстрого охлаждения подвергается

аморфизации [11], а плотность аморфного кремния ( $\rho_{\alpha\text{-Si}} = 2.285 \text{ g/cm}^3$ ) меньше, чем у кристаллического ( $\rho_{c\text{-Si}} = 2.328 \text{ g/cm}^3$ ) [11], образование блистерной структуры высотой 1-2 nm может быть связано именно со "вспучиванием" поверхности вследствие локального увеличения объема.

При  $F_0 = 0.44 \,\text{J/cm}^2$  внутри кольцевой структуры формируется микрократер глубиной 1 nm, окруженный массивным бортиком диаметром 2 µm, высотой 3.5 nm и шириной 540 nm (FWHM). Учитывая большую разницу в геометрических размерах бортика и микрополости относительно базовой линии поверхности, а также тот факт, что шероховатость микрократера соответствует исходной шероховатости полированного кремния (0.1 nm), можно предположить, что микрократер был сформирован в результате неабляционных процессов. Аналогичный микрократер с гладкой поверхностью и глубиной 4 nm формируется при  $F_0 = 0.5 \,\text{J/cm}^2$ , высота бортика при этом составляет также 4 nm. Предполагается, что в результате неоднородного нагрева поверхности лазерным импульсом с гауссовым распределением интенсивности при  $F_0 > F_{melt}$  образуется тонкий слой расплавленного кремния с радиальным температурным градиентом, направленным от центра к периферии. Движущей силой расплава может служить сила поверхностного натяжения, которая для кремния уменьшается с ростом температуры [13], что приводит к выталкиванию расплава из горячего центра к периферии с образованием характерного среднего массивного бортика.

При более высоких плотностях энергии  $F_0 = 0.6 \text{ J/cm}^2$  в центре микрократера глубиной ~ 8 nm в результате процесса абляции формируется наноструктурированная область с шероховатостью ~ 0.5 nm, окруженная корональным бортиком (crown-like rim) высотой 6 nm и шириной 110 nm (FWHM). Аналогичные микрократеры образуются при плотностях энергии вплоть до  $F_0 = 1.1 \text{ J/cm}^2$ , при этом корональный бортик формируется как ниже (0.6 J/cm<sup>2</sup>), так и выше (0.7 J/cm<sup>2</sup>) базовой линии поверхности.

Зависимости глубины микрократеров и высоты их бортиков от плотности энергии лазерного импульса  $F_0$  представлены на рис. 2, *a*. В зависимости от  $F_0$  глубина микрократера может быть меньше ( $F_0 < 0.45 \text{ J/cm}^2$ ), равна ( $0.48 < F_0 < 0.62 \text{ J/cm}^2$ ) и больше ( $F_0 > 0.62 \text{ J/cm}^2$ ) высоты окружающего бортика (вставка на рис. 2, *a*). При этом в области I преобладает гидродинамический механизм формирования микрократера, тогда как в области II подключается механизм абляции. При  $F_0 > 1.8 \text{ J/cm}^2$  высота бортика становится больше



**Рис. 2.** *а*) Зависимости глубины микрократеров (1) и высоты их бортиков (2) в воде, глубины микрократеров на воздухе (3) и отношения глубины микрократеров к высоте их бортика в воде (4) от плотности энергии лазерного импульса  $F_0$ . На вставке — увеличенное изображение в области  $F_0 = 0.35 - 0.85 \text{ J/cm}^2$ . *b*) Зависимость квадрата радиуса формируемых структур (трех бортиков) от логарифма энергии падающего лазерного импульса.

глубины микрократера. Глубина микрократера линейно зависит от  $F_0$  в исследуемом диапазоне, однако при  $F_0 > 0.7 \text{ J/cm}^2$  наклон линейной зависимости возрастает примерно в 3.2 раза, что приводит к образованию более глубоких кратеров, чем при абляции на воздухе. При этом линейная зависимость глубины абляционного кратера, полученного на воздухе (рис. 2, *a*), от плотности энергии в диапазоне  $F_0 = 0.2-1.9 \text{ J/cm}^2$  ранее также наблюдалась в работах [14–16]. На рис. 2, *a* показано отношение глубины микрократеров к высоте их бортика от  $F_0$ , характеризующее оптимальный диапазон значений  $F_0 = 0.9-1.1 \text{ J/cm}^2$ , при которых глубина формируемого микрократера в ~ 2.4 раза превышает высоту бортика и составляет ~ 50 nm.

Нелинейную зависимость квадрата диаметра кратера от плотности энергии в диапазоне  $F_0 = 4 - 20 \, \text{J/cm}^2$  при многократном воздействии ФЛИ на кремний в воде связывают с процессом кавитации [17] и эффективным удалением продуктов абляции [18]. В данном случае при однократном воздействии в припороговом диапазоне  $F_0 = 0.3 - 1.9 \,\mathrm{J/cm^2}$ нелинейная зависимость (рис. 2, b) наблюдается только для центрального коронального бортика (обозначен на рис. 1 цифрой 3), являющегося границей абляции. В отличие от процесса абляции в газовой среде (или в вакууме) взаимодействие абляционного факела с жидкой средой приводит к быстрому торможению выбрасываемого материала [19] и формированию плотного перегретого слоя расплава, при контакте с которым жидкость переходит в сверхкритическое состояние и преобразуется в расширяющуюся смесь жидкости и продуктов абляции, способствующую впоследствии процессу кавитации [20]. Наличие ограничивающего слоя жидкости также приводит к увеличению глубины расплавленного слоя за счет более близкого расположения подвергнутых абляции слоев к поверхности материала и процессов обратного рассеяния, приводящих к дополнительному нагреву облучаемого материала [21].

Вероятность пробоя жидкости на границе жидкость-воздух низка, поскольку при максимальной в эксперименте плотности энергии  $F_0 = 1.9 \text{ J/cm}^2$  интенсивность излучения на этой границе с учетом показателя преломления воды n = 1.33, длины Рэлея (перетяжки)  $z_r = 50 \,\mu\text{m}$  и толщины слоя воды 2 mm составит ~ 3% от максимальной интенсивности на границе кремний-вода, равной 5.4 TW/cm<sup>2</sup> (порог пробоя воды на длине волны  $\lambda = 1040 \text{ nm}$  при длительности импульса 340 fs составляет 3.37 TW/cm<sup>2</sup> [22]). Однако при плотности энергии  $F_0 > 1.2 \text{ J/cm}^2$  возможен объемный пробой воды вблизи границы кремний-вода с образованием расширяющейся со сверхзвуковой





скоростью электронно-ионной плазмы (20–400 ps) и последующей генерацией волны сжатия (> 1 ns) [23], воздействующей на расплав.

Кроме того, интересным представляется образование на поверхности микрократера характерного звездообразного отпечатка в диапазоне  $F_0 = 1.24 - 1.8 \text{ J/cm}^2$  (рис. 3), который исчезает при бо́льших плотностях энергии лазерного импульса.

Таким образом, в работе экспериментально получены наномасштабные кольцевые и блистерные структуры, а также гладкие и наноструктурированные микрократеры с минимальной глубиной 1 nm, сформированные в приповерхностных слоях кремния в результате их сверхбыстрого нагрева в воде фемтосекундным лазерным импульсом.

Работа выполнена в ЦКП "Лазерный фемтосекундный комплекс" ОИВТ РАН.

Автор благодарит сотрудников А.В. Овчинникова и Д.С. Ситникова за помощь в подготовке экспериментального стенда, а также М.Б. Аграната за обсуждение полученных результатов.

## Список литературы

- Phillips K.C., Gandhi H.H., Mazur E., Sundaram S. K. // Adv. Opt. Photon. 2015. V. 7. P. 684–712.
- [2] Malinauskas M., Žukauskas A., Hasegawa S., Hayasaki Y., Mizeikis V., Buividas R., Juodkazis S. // Light Sci. Appl. 2016. V. 5. P. e16133.
- [3] Chen C.-Yu., Chang T.-L. // Microelectron. Eng. 2015. V. 143. P. 41-47.
- [4] Korte F., Serbin J., Koch J., Egbert A., Fallnich C., Ostendorf A., Chichkov B.N. // Appl. Phys. A. 2003. V. 77. P. 229–235.
- [5] Derrien T. J.-Y., Koter R., Kruger J., Hohm S., Rosenfeld A., Bonse J. // J. Appl. Phys. 2014. V. 116. P. 074902.
- [6] Izawa Y., Tokita S., Fujita M., Nakai M., Norimatsu T., Izawal Y. // J. Appl. Phys. 2009. V. 105. P. 064909.
- [7] Izawa Y, Tokita S., Fujita M., Norimatsu T., Izawa Y. // Appl. Surf. Sci. 2009.
  V. 255. P. 9764–9769.
- [8] Ромашевский С.А., Ашитков С.И., Дмитриев А.С. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. В. 15. С. 78–85.
- [9] Romashevskiy S.A., Ashitkov S.I., Ovchinnikov A.V., Kondratenko P.S., Agranat M.B. // Appl. Surf. Sci. 2016. V. 374. P. 12–18.
- [10] Romashevskiy S.A., Ashitkov S.I., Agranat M.B. // Appl. Phys. Lett. 2016. V. 109.
  P. 261601.
- [11] Bonse J., Brzezinka K.-W., Meixner A.J. // Appl. Surf. Sci. 2004. V. 221. P. 215– 230.
- [12] Sasaki H., Tokizaki E., Terashima K., Kimura S. // Jpn. J. Appl. Phys. 1994.
  V. 33. P. 3803–3807.
- [13] Shishkin A.V., Basin A.S. // Theor. Found Chem. Eng. 2004. V. 38. P. 660-668.
- [14] Polek M., Hassanein A. // Laser Part. Beams. 2016. V. 34. P. 143–150.
- [15] Hwang D.J., Grigoropoulos C.P., Choi T.Y. // J. Appl. Phys. 2006. V. 99. P. 083101.
- [16] Ding P.J., Liu Q.C., Lu X., Liu X.L., Sun S.H., Liu Z.Y., Hu B.T., Li Y.H. // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 2012. V. 286. P. 40–44.
- Besner S., Degorce J.-Y., Kabashin A.V., Meunier M. // Appl. Surf. Sci. 2005.
  V. 247. P. 163–168.
- [18] Daminelli G., Krüger J., Kautek W. // Thin Solid Films. 2004. V. 467. P. 334– 341.
- [19] Hu H., Liu T., Zhai H. // Opt. Express. 2015. V. 23. P. 628-635.
- [20] Shih C.-Y., Wu C., Shugaev M.V., Zhigilei L.V. // J. Colloid Interface Sci. 2017. V. 489. P. 3–17.
- [21] Povarnitsyn M.E., Itina T.E. // Appl. Phys. A. 2014. V. 117. P. 175-178.
- [22] Vogel A., Linz N., Freidank S., Paltauf G. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 100. P. 038102.
- [23] Schaffer C.B., Nishimura N., Glezer E.N., Kim A.M.-T., Mazur E. // Opt. Express. 2002. V. 10. P. 196–203.
- 5 Письма в ЖТФ, 2018, том 44, вып. 14